

2017年度精密工学会秋季学術講演会  
「プラナリゼーションCMPとその応用」  
9月20日(水)開催 大阪大学豊中キャンパス(A室)

	講演番号	講演者所属	講演者氏名	演題
9:00	173460	大阪大学	中平雄太	触媒表面基準エッチング法における水素水を用いた加工速度の安定化手法による加工速度の向上
9:20	173006	日本ポール	角屋正人	CMPスラリーろ過におけるフィルター細孔表面への砥粒吸着とろ過特性の検討
9:40	173011	ニッタ・ハース	木村 浩	シリカスラリーの安定性がディフェクト性能に与える影響
10:00	173346	荏原製作所	半田直廉	ウェーハ回転時の液流れにおける粒子除去特性
10:20				
10:40	173027	ニッタ・ハース	杉田規章	複数種の水溶性高分子を用いた低欠陥・高平滑性シリコンウェーハ研磨用スラリーの開発
11:00	173398	九州大学	黒周周平	コロイダルセリア砥粒の凝集状態に着目した石英ガラス基板研磨
11:20	173033	金沢工業大学	水内伸哉	活性ガス内包ナノバブル添加スラリー供給装置の開発とそれによるSiC基板の高効率CMPの試み
11:40	173128	埼玉大学	佐野侑希	酸化セリウム砥粒がガラス研磨に及ぼす影響要因に関する研究
12:00	屋 食 休 憩 (80分)			
12:20				
12:40				
13:00				
13:20				
13:40	173455	岡本工作機械製作所	伊東利洋	GaN研磨加工高効率化の研究 -紫外線直接照射が可能な光透過型研磨定盤の試作とその効果(第2報)-
14:00	173254	大阪大学	木田英香	光電気化学酸化を援用した触媒表面基準エッチング法によるGaN基板の高効率平坦化
14:20				
14:40	173467	金沢大学	橋本洋平	矩形加工物の両面研磨における研磨量の推定
15:00	173368	大阪大学	両桑玲志	表面吸着活性種の輸送を用いたドライ平坦化法の開発
15:20	173142	埼玉大学	加藤大輝	メカノケミカルPVA砥石の作製と性能評価に関する研究
15:40	173043	クリスタル光学	桐野宙治	Water-CAREを用いた高機能マイクロテクスチャ製造技術の開発
16:00				
16:20	173225	山梨大学	瀬川紘幹	マイクロ流通セルを用いたBTA-H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 混合溶液中におけるCu表面のその場分光エリブソメトリ解析
16:40	173359	山梨大学	鈴木雄也	エリブソメトリ法によるSi基板表面の微粒子計測 -インジェット装置による粒子付着とエリブソメトリ計測-
17:00	173365	九州大学	林 照剛	フェムト秒レーザーを用いたダブルパルスビームによる励起状態面の表面加工に関する研究(第8報) -低ダメージレーザー照射技術の表面洗浄への応用-
17:20	173363	大阪大学	藤 大雪	ニッケル触媒を利用した純水ベースの触媒表面基準エッチング法の開発